

次世代リソグラフィ技術研究会企画

半導体リソグラフィ 技術の基礎

参加費
無料

半導体デバイス製造プロセスにおいて、リソグラフィ技術は、微細加工を担う極めて重要な技術である。しかし、リソグラフィ技術のカバーする技術領域は、結像光学、ビーム応用工学、精密工学、化学反応論、情報工学など多岐にわたるため、デバイスメーカ、装置メーカ、材料メーカなどでも、社内でリソグラフィ技術全般の教育を実施するのは難しい。また、大学においても、デバイス開発等の手段としてリソグラフィ技術を使用する研究者や学生は多いが、リソグラフィ技術そのものを研究テーマとする講座はほとんどないため、リソグラフィに関する教育を実施するのは難しい。このような事情から、本スクールでは、国内でリソグラフィ技術の各領域を代表する方々に講師となっただき、リソグラフィ技術の理解を必要とする企業の若手エンジニアや学生を対象に、リソグラフィの基礎知識を習得する機会を提供する。

期日 2012年3月16日(金) 春季講演会2日目
会場 早稲田大学 早稲田キャンパス C1会場(10号館1階109)
住所: 東京都新宿区西早稲田1-6-1
定員 200名

プログラム

10:00~10:05	ごあいさつ 人材育成委員会委員長 末光 眞希(東北大)	13:00~14:00	EUVリソグラフィ 村上 勝彦(ニコン)
10:05~10:35	リソグラフィ技術の概要 岡崎 信次(ギガフォトン)	14:00~15:00	EB・マスクレスリソグラフィ 山部 正樹(富士通セミコンダクター)
10:35~11:50	光リソグラフィ 鈴木 章義(キヤノン)	15:00~15:15	休憩
11:50~13:00	昼食	15:15~16:15	マスク技術 法元 盛久(大日本印刷)
		16:15~17:15	レジスト技術 古澤 孝弘(阪大)

問合せ先

公益社団法人 応用物理学会 事務局 岡本
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-22 湯島アーバンビル7F
Tel: 03(5802)0861 Fax: 03(5802)6250 E-mail: soka@jsap.or.jp